

# Applications industrielles de l'ellipsométrie et de la réflectométrie X pour les couches minces

analyse a2

p. 31



## OBJECTIFS

Ce stage de deux jours est destiné aux techniciens, ingénieurs et chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'optoélectronique, de la microélectronique et/ou mécanique. Il est destiné à élargir leurs connaissances et leurs savoir-faire concernant la caractérisation des couches minces pour des applications à la mécanique, à l'optoélectronique et à l'électronique.

Après un exposé des principes physiques et des méthodes expérimentales, les principales applications aux semi-conducteurs seront présentées.

Une journée sera consacrée à des expériences réalisées sur des équipements récents mis à disposition par les constructeurs.

## PROGRAMME

### COURS

- Rappel des lois de l'optique
- Méthodes de mesures ellipso-métriques
- Optique des rayons X
- Application à la réflectométrie
- Applications aux biocapteurs et aux semi-conducteurs

### TRAVAUX PRATIQUES ET DÉMONSTRATION

- Ellipsométrie visible, ultra-violet et éventuellement infra-rouge
- Reflectrométrie X



### Durée :

2 jours / 14 heures

### Dates :

➤ 7 / 8 décembre 2010

### Lieu :

LGP Orsay

### Prix :

Adhèrent ..... 750 €  
Non adhérent ..... 850 €

### Niveau : I - II - III

### TP : 50 %

### Documents :

Texte des cours

### Animateur :

**Marie-Christine HUGON**  
Maitre de Conférence  
marie-christine.hugon@  
pgp.u-psud.fr

Avec la participation  
de la société **SOPRA**  
**Christophe DEFRANOUX**  
**Olivier DULAC**  
**Jean-Philippe PIEL**

